

CCP플라즈마의 조건에 따른 EEDF와 Radical변화

이헌수, 유신재, 장홍영

KAIST 물리학과 저온플라즈마 실험실

13.56MHz로 구동되는 *Capacitively coupled plasma*에서, Probe와 QMS를 이용하여 플라즈마 특성을 연구하였다. 외부 변수의 변화에 따라 EEDF의 변화를 관찰하였고, 이에 따라 radical의 분포가 급격히 변화하는 것을 확인할 수 있었다. Radical의 분포는 공정 결과와 직접적인 관련을 맺고 있으므로, EEDF와 Radical의 관계를 본 연구를 통해 밝힘으로써, 차후 차세대 공정에서 EEDF 제어를 통한 공정 Control의 가능성을 보여준다.